【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和3年7月26日(2021.7.26)

【公開番号】特開2019-219508(P2019-219508A)
【公開日】令和1年12月26日(2019.12.26)
【年通号数】公開・登録公報2019-052
【出願番号】特願2018-116625(P2018-116625)
【国際特許分類】
Ｇ０３Ｆ　7/20　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/683　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/677　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０３Ｆ　7/20　５０１
Ｇ０３Ｆ　7/20　５２１
Ｈ０１Ｌ　21/68　Ｐ
Ｈ０１Ｌ　21/68　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】令和3年6月4日(2021.6.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
保持面上で基板を保持する基板ステージと、
前記基板の上面を吸引することで、前記基板を前記基板ステージから浮上させた状態で支持する吸引部と、
前記吸引部により支持された前記基板を前記保持面に直交する軸回りに回転させる駆動機構と、
を備えることを特徴とする基板回転装置。
【請求項２】
前記吸引部は、前記基板の上面に対し、気体を噴出することで、前記基板を前記基板ステージから浮上させた状態で支持する、ことを特徴とする請求項１に記載の基板回転装置。
【請求項３】
前記吸引部は、前記基板を吸引するための微小孔が形成された多孔質パッドを含む、ことを特徴とする請求項１または２に記載の基板回転装置。
【請求項４】
前記多孔質パッドは、前記基板の大きさと同程度またはそれよりも大きい、ことを特徴とする請求項３に記載の基板回転装置。
【請求項５】
前記基板ステージは、前記吸引部が前記基板を吸引可能な位置に前記基板を移動させるために、前記保持面に直交する方向に沿って昇降可能な昇降部を備える、ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の基板回転装置。
【請求項６】
前記昇降部は、前記基板と接触する面に前記基板を吸着保持する第１吸着部を備える、ことを特徴とする請求項５に記載の基板回転装置。

【請求項７】
前記第１吸着部は、前記吸引部による前記基板の吸引が開始された後に吸着を停止する、ことを特徴とする請求項６に記載の基板回転装置。
【請求項８】
前記駆動機構は、前記基板ステージに備えられる、ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の基板回転装置。
【請求項９】
前記基板ステージは、前記基板の下面の中央部を吸着保持する保持部材を備え、
前記駆動機構は、前記保持部材を回転させることにより、前記保持部材によって吸着保持された前記基板を回転させる、ことを特徴とする請求項８に記載の基板回転装置。
【請求項１０】
前記保持部材は、前記基板の下面と接触する面に複数の第２吸着部を備える、ことを特徴とする請求項９に記載の基板回転装置。
【請求項１１】
前記駆動機構は、前記吸引部に備えられる、ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の基板回転装置。
【請求項１２】
前記吸引部は、前記基板の端部と当接することで、前記基板を支持する当接部材を備え、
前記駆動機構は、前記吸引部を回転させることにより、前記当接部材によって支持された前記基板を回転させる、ことを特徴とする請求項１１に記載の基板回転装置。
【請求項１３】
保持面上で基板を保持する工程と、
前記基板の上面を吸引することで、前記基板を基板ステージから浮上させた状態で支持する工程と、
前記支持する工程において支持された前記基板を前記保持面に直交する軸回りに回転させる工程と、
を含むことを特徴とする基板回転方法。
【請求項１４】
基板上にパターンを形成するリソグラフィ装置であって、
請求項１乃至１２のうちいずれか１項に記載の基板回転装置を含む、ことを特徴とするリソグラフィ装置。
【請求項１５】
請求項１４に記載のリソグラフィ装置を用いて基板にパターンを形成する工程と、
前記工程でパターンが形成された前記基板を加工する工程と、
を含むことを特徴とする物品の製造方法。